保土谷化学
HODOGAYA

水稲栽培に
酸素供給剤

健苗育成

高温対策

このような課題・リスクを解決することができます！

1

種子は発芽阻害物質を
含むため、休眠状態に。

2

省スペースによる
生育環境で
育苗にムラが発生

3

高温期の根痛み、
水田での酸素欠乏、
嫌気条件によるメタンや
硫化水素ガスが発生

発芽勢改善

過酸化水素は発芽抑制物質を失活させるため、種子を休眠状態から起こすができる！

健苗育成

酸素を供給することで低温化での根の活力低下・過湿による根いたみを軽減。養水分吸収を健全化することにより育苗ムラを予防。

ガス害対策

酸素を補うことにより有機物の分解を促進、嫌気条件を改善し、ガス発生による生育不良を予防。

酸素発生の仕組み

粒剤

ネオカルオキソ、ネハリエース

過酸化カルシウムを成分とした粒剤で、土壌中の水分と反応することで持続的（1～3ヶ月）に酸素を発生しながら消石灰となり、最終的には炭酸カルシウムとなります。



CaO_2 過酸化カルシウム ＋ H_2O 土壌中の水 → $1/2\,O_2$ 酸素 ＋ $Ca(OH)_2$ 消石灰

液剤

M・O・X

過酸化水素水を成分とした液剤で、土壌中の金属や有機物に触れて分解し、酸素を短期間に放出して、最終的には水になります。



H_2O_2 過酸化水素水 ＋ 土壌中の金属類 → $1/2\,O_2$ 酸素 ＋ H_2O 水

M・O・Xの育苗に対する施用効果

処理時期　出芽時、出芽後5日目、出芽後10日目（計3回）

区名	苗令（枚）	苗丈（cm）	葉身長（cm）		生体重（g/100本）		乾物重（g/100本）		R/T※（%）	総根長（cm）
			第1	第2	地上部	地下部	地上部	地下部		
標準区	2.3	11.3	1.6	6.4	6.11	2.80	1.26	0.34	27.0	17.0
M・O・X	2.2	11.3	1.6	6.5	6.53	3.70	1.32	0.51	38.6	19.7

※R/T（%）＝（地下部乾物重÷地上部乾物重）×100

ガス害対策の仕組み

1. 酸素は有害ガスを発生させずに有機物を分解します。
2. 有害ガスは土壌中の酸素が欠乏することで発生しますが、酸素を供給することで環境が改善され、有害ガスの発生抑制が期待されます。
3. 酸素が硫化水素と反応して無害化することができます。



H_2S（硫化水素）＋ $1/2\,O_2$（酸素）→ S（硫黄）＋ H_2O（水）

使用方法

〈目的〉	〈時期〉		
発芽勢改善	種子浸漬時	MOX	50倍希釈液に種子を12～24時間浸漬する
健苗育成	出芽時・出芽5日目・出芽10日目	MOX	100倍希釈液を育苗トレー1枚当たり500mL灌注する
	根が弱っているとき	MOX	50倍希釈液を育苗トレー1枚当たり500mLずつ3回灌注する
ガス害対策	代かき前	ネオカルオキソ	10a当たり10～20kg施用する
	生育期	ネハリエース	10a当たり10～20kg施用する
		MOX	10a当たり10kg施用する（水口から流し込む）

荷姿



ネオカルオキソ



ネハリース

ポリ袋/10kg入り



M・O・X

外装：ダンボール 内装：キュービテナー/10kg入り

製品特集ページ

保土谷化学工業株式会社
HODOGAYA

〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目9番2号
TEL 03-6852-0380（問合せ専用）
お問い合わせ先：https://www.hodogaya.co.jp/info/cntct_agr/